课前作业 28 小结

一、 主观题

1) L28P2, 为什么此页的 V0 是变数 (如课上同学所问), 其对 Cd 的影响是如何通过后面的电荷灵敏前置放大器的设置该被消除的?

参考答案: 固定的电源电压 V 将在探测器两端和外电阻上分配。当入射射线在探测器内引起感应电流信号后,电流将流过外电阻造成压降。由于探测器电流的大小不是固定的,因此压降也不是固定的,于是探测器两端电压 V0 是变数。由密勒效应可知,电荷灵敏前置放大器等效到输入端的电容为 $(1+A)C_f\gg C_d$,感应信号电荷几乎都经过 C_f , C_d 的贡献可以忽略。因此消除了变化的结区电容 C_d 对能量测量造成的影响。

2) L28P18,为什么 R_fC_f 要如此选择数值,解释下原因?

参考答案: 首先,输出脉冲幅度 $V_{\max} \approx \frac{Ne}{C_f}$,半导体探测器未经过载流子的倍增过程,需要选择小的 C_f 来增大输出脉冲幅度,以便提高信噪比,一般选择为 pF 量级。而为了降低弹道亏损对输出信号幅度的影响,需保证探测器输出回路的时间常数 R_0C_0 远大于载流子的收集时间,常用的 $R_0C_0 \approx R_fC_f$ 约在毫秒量级,故 R_f 的大小在 $G\Omega$ 水平。

3) 持续地增大 PN 结探测器的工作电压,对于探测器形成的影响有利有弊,分别是什么?

参考答案:

● 利:持续地增大 PN 结探测器的工作电压,将使得探测器的结电容减小,有

利于减少电荷灵敏前置放大器的输出噪声;此外,也将使得结区宽度变大, 增大探测器的灵敏体积。

- 弊:将导致反向电流的增大,对探测器系统的噪声造成不利影响,而且有可能加压过高击穿探测器,导致探测器的损坏。
- 4) 金硅面垒探测器 vs 高纯锗探测器, 异与同分别是什么?

参考答案:

同:均为 PN 结探测器。

异: 两者的材料纯度不同,导致了结区宽度的差异。高纯锗的结区宽度可达 cm 量级,因此可以测量 γ 射线;而金硅面垒探测器的结区宽度仅为 mm 量级,只能测量重带电粒子这种短程粒子。有同学谈到使用条件的区别,注意高纯锗是可以在常温保存,但得在低温下使用,而金硅面垒探测器是可以在常温下使用的。

5) L28P60, 如何理解, 探测器的尺寸越大, 峰康比越大?

参考答案:探测器的尺寸越大,灵敏体积越大,射线越有可能在灵敏体积内沉积全部能量,因此峰康比越大。

- 二、 形成全能峰的时候,最后一步光原子反应是什么? 参考答案: A。光电效应。
- 三、 如果某放射源可以产生两个能量的 γ 射线,能量分别为 E1 和 E2,则在保持源探关系不变的前提下,无论源的活度如何,在 γ 能谱中只能看到两个全能峰(分别对应 E1 和 E2)?

参考答案: 错误。在源的活度较高的情况下还有可能形成合峰(E1+E2)

四、 γ能谱的下列特征中,与光子逃逸有关的是?

参考答案: C; D; E; F; G; K。 错误答案中 H, I, J选的同学较多, 注意湮没峰是 γ 射线在环境中产生的 511keV 光子进入探测器导致的; 反散射峰是光子在环境中发生大角度康普顿散射后, 散射光子进入探测器导致的, 均不涉及探测器内的光子逃逸。而特征 X 射线峰可能有些同学把它和光电峰弄混了。康普顿散射光子、湮没光子、环境本底光子等都可能在探测器内或周围材料中发生光电效应. 导致对应材料的特征 X 射线峰的出现。

五、 在开展符合实验的时候,若符合电路的分辨时间 τs 保持不变,任意调整 两路信号的相对延迟时间 τd, 对输出符合信号一定有贡献的是?

参考答案: 偶然符合。真符合从物理上是有明确的时间依赖关系的。

六、 下面哪一项会影响符合系统的真偶符合比?

参考答案: A;D。

$$\frac{n_{co}}{n_{rc}} = \frac{1}{2\tau_s A}$$